

專利局動態

[全球]

五大工業設計局 (ID5) 論壇召開年度大會

ID5 於 2017 年 12 月 4 日和 5 日在西班牙阿利坎特召開第 3 屆年度大會，會中 ID5 彙集關於 5 局設計制度的比較研究，著重於設計的保護條件，例如可被保護的設計範圍、設計申請案圖式揭露要求、主張國外優先權實務、用於檢索設計的設計分類系統以及設計申請案和審查之統計數據。這些成果有助於未來設計制度和運作之國際調和，此外，ID5 同意未來開放報告供大眾使用並創建 ID5 官網作為資訊分享平台。

ID5 表示未來將持續推動關於新技術的設計保護研究，例如來自數位科技的新設計，諸如圖形化使用者介面 (graphical user interfaces, GUI) 的部分設計和優惠期的實務。

資料來源：“Third Industrial Design 5 Forum (ID5) Annual Meeting Held - International cooperation advancing to develop a global-level environment for protecting designs -,” JPO. 2017 年 12 月 6 日。
<http://www.jpo.go.jp/shoukai_e/soshiki_e/photo_gallery2017120501.htm >

[印度]

印度專利局朝著降低審查過程延遲的目標前進

眾所皆知印度專利局處理案件需耗費相當長的時間，然此狀況可能改變。根據瞭解，印度政府欲透過簡化智慧財產程序以及將專利局打造得更加現代化的手段，以達到強化智慧財產權的目的。

印度專利局已經引進專利與商標的電子申請設備，以及為了達到平均分配及利用所有審查委員專長目的，自動化指派專利申請案給相關審查委員。為了能夠將目前專利審查耗時 7 年的時間縮短到 18 個月，2019 年目標的第一步為增加新招聘審查委員。另外，印度專利局日前針對待審專利申請案實施簡訊通知系統的服務，即於申請過程中，會發送有關該待審專利申請案進度予申請人及代理人，內容包含形式審查所需耗費時間，此措施可協助申請人知悉該待審專利申請案的進度，及時採取必要行動。

資料來源：“Initiatives underway to reduce examination delays,” Shelston. 2017 年 12 月。